

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

I. Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:

Název zadavatele	Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo zadavatele Identifikační číslo	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 306 14 497 77 513
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka
Název veřejné zakázky	Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu část 1: Komplex přístrojů pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu
Druh řízení	otevřené nadlimitní řízení
Evidenční číslo zakázky	374562

II. Předmět veřejné zakázky, zvolený druh zadávacího řízení:

Zadavatel odeslal dne 14. 4. 2014 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o veřejné zakázce s názvem „Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu“, přičemž tato veřejná zakázka byla ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněna dne 18. 4. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 374562. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky podle ustanovení § 8 ZVZ, jejímž předmětem je dodávka zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu.

Veřejná zakázka byla v souladu s ustanovením § 98 ZVZ, rozdělena na dvě části, přičemž uchazeči byli oprávněni podat nabídku do obou částí veřejné zakázky nebo pouze do jedné z nich. Veřejná zakázka byla rozdělena na části takto:

Část	Název části
1.	Komplex přístrojů pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu
2.	Komplex přístrojů pro provádění rutinních metalografických pozorování a analýz a použití vysokoteplotního deformačního zařízení



Tato písemná zpráva zadavatele se vztahuje pouze k části první shora uvedené veřejné zakázky s názvem „Komplex přístrojů pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu“.

Předmětem části první shora uvedené veřejné zakázky s názvem „Komplex přístrojů pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu“ byla dodávka komplexu přístrojů pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu, jehož součástí je dual beam SEM-FIB mikroskop s BSE, SE, EDS, EBSD, STEM, příslušenství zahrnující nanomanipulátor, mono-GIS a zařízení pro tahové a tlakové zkoušky velmi malých vzorků. Součástí systému je dále i software pro snímání a analýzu naměřených dat a ovládání iontového svazku.

III. Identifikační údaje vybraného uchazeče, cena sjednaná ve smlouvě:

Zadavatel uzavřel dne 9. 12. 2014 kupní smlouvu na dodávku shora uvedeného komplexu přístrojů s následujícím uchazečem:

Carl Zeiss spol. s r.o.

společnost s ručením omezeným

IČO: 493 56 691

se sídlem Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 15000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19868

Cena za dodávku výše uvedeného zařízení tvořícího předmět shora uvedené veřejné zakázky činí dle kupní smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem celkem **21.890.000,- Kč bez DPH**.

IV. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Ve lhůtě pro podání nabídek byly do části první veřejné zakázky podány celkem tři nabídky, a to ze strany níže uvedených uchazečů:

Pořadové číslo nabídky	Identifikace uchazeče	Nabídková cena bez DPH
1.	Carl Zeiss spol. s r. o. společnost s ručením omezeným IČO: 493 56 691 se sídlem Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19868	21.890.000,- Kč
2.	TESCAN Brno, s. r. o. společnost s ručením omezeným IČO: 017 33 214 se sídlem Brno – Kohoutovice, Libušina třída 816/1, PSČ 623 00 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78909	19.890.000,- Kč

3.	LAO – průmyslové systémy, s.r.o. společnost s ručením omezeným IČO: 257 05 512 se sídlem Praha 4 - Modřany, Na Floře 1328, PSČ 143 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62830	21.950.000,- Kč
----	---	-----------------

V. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení s odůvodněním jejich vyloučení:

U všech shora uvedených uchazečů bylo hodnotící komisí posouzeno prokázání splnění kvalifikace z hlediska požadavků ustanovení § 59 odst. 1 ZVZ a zároveň byly v souladu s ustanovením § 76 a § 77 ZVZ posouzeny nabídky těchto uchazečů. V této souvislosti došlo ze strany hodnotící komise k vyřazení nabídky níže uvedeného uchazeče, který byl následně zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení na zadání shora uvedené veřejné zakázky.

a) Vyloučení uchazeče, který podal nabídku s pořadovým číslem 2

TESCAN Brno, s. r. o.

společnost s ručením omezeným

IČO: 017 33 214

se sídlem Brno – Kohoutovice, Libušina třída 816/1, PSČ 623 00

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78909

Zadavatel stanovil v článku 3.1. zadávací dokumentace minimální technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jakožto obligatorní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, s tím, že nebude-li zařízení, které uchazeč v rámci své nabídky zadavateli nabídne, odpovídat všem technickým parametrům zde uvedeným nebo nebude-li obsahovat všechny stanovené součásti, bude takový uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v zadávacím řízení.

V čl. 4.5. zadávací dokumentace zadavatel dále stanovil, že technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží popis a zobrazení zařízení určeného k dodání, přičemž z detailního technického popisu musí vyplývat splnění všech technických podmínek uvedených v bodě 3. zadávací dokumentace.

Pokud se jedná o konkrétní požadavky zadavatele na poptávané zařízení, vymezil zadavatel v čl. 3.1. zadávací dokumentace, oddíle 1.1. nazvaném SEM-FIB mikroskop, minimální parametry elektronové soustavy, přičemž požadoval, aby tato disponovala níže uvedeným rozlišením:

- rozlišení < 1 nm @ 30 kV (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek),
- rozlišení ≤ 1,1 nm @ 15 kV (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek) a
- rozlišení ≤ 2 nm @ 1 kV (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek).

V rámci dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám ze dne 5. 6. 2014 (konkrétně v rámci odpovědi na dotaz dodavatele č. 1, který se týkal rozlišení elektronové soustavy a ve kterém se dodavatel dotazoval, zda zadavatel akceptuje dosažení požadovaného rozlišení za použití imerzního objektivu, případně potenciálu na vzorku) zadavatel svůj výše uvedený požadavek na minimální parametry elektronové soustavy zcela jednoznačným způsobem potvrdil, když uvedl, že všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci jsou pro zadavatele klíčové. V dané

souvislosti zadavatel doplnil, že uchazeči mohou nabídnout i zařízení s technickými parametry, které jde nad rámec minimálních technických parametrů stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V rámci podrobné technické specifikace zboží tvořící přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, kterou byli uchazeči v souladu s čl. 5.1. zadávací dokumentace povinni v rámci svých nabídek předložit, společnost TESCAN Brno, s. r. o. (dále také jen „uchazeč č. 2“) mimo jiné uvedla, že jím nabízená elektronová soustava disponuje níže uvedeným rozlišením:

- rozlišení $< 1 \text{ nm @ } 30 \text{ kV}$ (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek),
- rozlišení $\leq 1,1 \text{ nm @ } 15 \text{ kV}$ (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek) a
- rozlišení $\leq 2 \text{ nm @ } 1 \text{ kV}$ (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek).

V rámci podrobného popisu systému označeného jako „Specification of the Combined High Resolution FE-SEM/FIB“, který uchazeč č. 2 předložil ve své nabídce, však uchazeč č. 2 uvedl (konkrétně na str. 20 nabídky), že požadovaného rozlišení lze dosáhnout pouze s využitím BD módu. Na str. 23 téhož dokumentu pak uchazeč uvedl, že BD je spojeno se záporným napětím na stolku/vzorku.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel výzvou ze dne 11. 7. 2014 vyzval uchazeče č. 2 (i) k objasnění rozporu podrobného popisu systému označeného jako „Specification of the Combined High Resolution FE-SEM/FIB“ s výše uvedenými požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách a dále k (ii) předložení popisu příslušné části nabízeného zařízení, ze kterého bude vyplývat, jak vysokého rozlišení systému bude dosaženo při splnění technických požadavků stanovených zadavatelem.

K výzvě zadavatele uchazeč č. 2 dne 24. 7. 2014 s odkazem na dodatečné informace č. 2 ze dne 5. 6. 2014 uvedl, že použití BD módu (napětí na stolku) nijak neomezuje použití vzorků s libovolnými magnetickými vlastnostmi. Současně uchazeč č. 2 poukázal na to, že v odpovědi na přímý dotaz uchazeče č. 2 v žádosti o dodatečné informace zadavatel využití záporného napětí na stolku nevyloučil. Současně zdůraznil, že použití Beam Deceleration Technology (BDT)/BD módu/napětí na stolku nijak neomezuje práci s kovovými i nekovovými vzorky s různými magnetickými vlastnostmi včetně vzorků s velmi malými oblastmi s různými magnetickými vlastnostmi a není v rozporu ani s žádným jinými požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci ani v odůvodnění vymezení technických podmínek. V rozporu s požadavkem zadavatele obsaženým ve výzvě ze dne 11. 7. 2014 pak uchazeč č. 2 žádný popis příslušné části nabízeného zařízení, ze kterého by vyplývalo, jak vysokého rozlišení systému bude dosaženo při splnění technických požadavků stanovených zadavatelem, nepředložil.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel proto výzvou ze dne 11. 8. 2014 vyzval uchazeče č. 2 v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 ZVZ k písemnému vysvětlení nabídky, a to konkrétně k jednoznačné odpovědi na to, zda splňuje uchazečem č. 2 nabízené zařízení veškeré požadavky zadavatele na předmět shora specifikované veřejné zakázky, a to zejména požadavek na:

- rozlišení $< 1 \text{ nm @ } 30 \text{ kV}$ (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek),
- rozlišení $\leq 1,1 \text{ nm @ } 15 \text{ kV}$ (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek) a
- rozlišení $\leq 2 \text{ nm @ } 1 \text{ kV}$ (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek).



K výzvě zadavatele k písemnému vysvětlení nabídky uchazeč č. 2 sdělením ze dne 18. 8. 2014 uvedl, že:

- pokud jde o rozlišení $< 1 \text{ nm @ } 30 \text{ kV}$ (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek) nabízené zařízení dosahuje rozlišení $0,9 \text{ nm}$ při 30 kV při zobrazení prošlých elektronů (R-STEM detektor),
- pokud jde o rozlišení $\leq 1,1 \text{ nm @ } 15 \text{ kV}$ (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek) nabízené zařízení dosahuje rozlišení $1,1 \text{ nm}$ při 15 kV při zobrazení prošlých elektronů (R-STEM detektor) a
- pokud jde o rozlišení $\leq 2 \text{ nm @ } 1 \text{ kV}$ (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek) nabízené zařízení dosahuje rozlišení $2,0 \text{ nm}$ při 1 kV při zobrazení sekundárních elektronů za použití potenciálu na vzorku (Beam Deceleration Technology).

Současně uchazeč č. 2 uvedl, že jeho nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek, byť požadavek na rozlišení $\leq 2 \text{ nm}$ při urychlovacím napětí splňuje pouze za použití potenciálu na vzorku.

Vzhledem popsanému nedostatku nabídky uchazeče č. 2, který vyplývá z jejího vysvětlení ze dne 18. 8. 2014 předloženého uchazečem č. 2 hodnotící komise dospěla k závěru, že uchazeč č. 2 neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu uvedeného v čl. 4.5. zadávací dokumentace, kdy zadavatel stanovil, že technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží popis a zobrazení zařízení určeného k dodání, přičemž z detailního technického popisu musí vyplývat splnění všech technických podmínek uvedených v bodě 3. zadávací dokumentace. Jak shora uvedeno, zadavatel požadoval, aby elektronová soustava disponovala mimo jiné rozlišením $\leq 2 \text{ nm @ } 1 \text{ kV}$ (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek), když na tomto svém požadavku zadavatel jednoznačně setrval i v rámci odpovědi na dotaz dodavatele poskytnuté v rámci dodatečných informací č. 2. Uchazeč č. 2 však v rozporu s uvedeným požadavkem zadavatele v rámci své nabídky nabídl dodat zařízení, které požadavek na rozlišení $\leq 2 \text{ nm}$ při urychlovacím napětí splňuje pouze za použití potenciálu na vzorku. Z uvedeného důvodu pak hodnotící komise dospěla rovněž k závěru, že nabídka uchazeče č. 2 nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Hodnotící komise tak na základě výše uvedených skutečností rozhodla o vyřazení nabídky uchazeč č. 2, společnosti TESCOAN Brno, s. r. o., ze zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu, část 1: Komplex přístrojů pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu, a to z důvodu neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů a dále z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Zadavatel se se závěrem hodnotící komise ztotožnil a následně dne 12. 9. 2014 v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 ZVZ a v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ rozhodl o vyloučení uchazeče č. 2 ze zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu, část 1: Komplex přístrojů pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu.

VI. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadavatel posoudil v souladu s ustanovením § 76 a § 77 ZVZ nabídky, které nebyly vyřazeny, a shledal, že nabídky těchto níže uvedených uchazečů splnily (i) zákonné požadavky a požadavky zadavatele ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 ZVZ, (ii) u žádné z těchto nabídek se nejednalo o nepřijatelnou nabídku dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ a (iii) u žádné z těchto nabídek se nejednalo o nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve smyslu ustanovení § 77 ZVZ. Hodnoceny byly nabídky níže uvedených uchazečů:

Pořadové číslo nabídky	Identifikace uchazeče
1.	Carl Zeiss spol. s r. o. společnost s ručením omezeným IČO: 493 56 691 se sídlem Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19868
3.	LAO – průmyslové systémy, s.r.o. společnost s ručením omezeným IČO: 257 05 512 se sídlem Praha 4 - Modřany, Na Floře 1328, PSČ 143 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62830

Zadavatel hodnotil nabídky dle základního hodnotícího kritéria nabídky s nejnižší nabídkovou cenou ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) ZVZ. Výsledné pořadí uchazečů bylo stanoveno takto:

Výsledné pořadí	Pořadové číslo	Uchazeč	Nabídková cena v Kč bez DPH
1. místo	1.	Carl Zeiss spol. s r. o. společnost s ručením omezeným IČO: 493 56 691 se sídlem Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19868	21.890.000,- Kč
2. místo	3.	LAO – průmyslové systémy, s.r.o. společnost s ručením omezeným IČO: 257 05 512 se sídlem Praha 4 - Modřany, Na Floře 1328, PSČ 143 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62830	21.950.000,- Kč



VII. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Uchazeč, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, ve své nabídce dle požadavku zadavatele uvedeného v čl. 5.5 zadávací dokumentace neuvedl, že by měla být některá část veřejné zakázky plněna prostřednictvím subdodavatele.

V Plzni dne 19 -12- 2014



.....
Západočeská univerzita v Plzni
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka

